

半導体素子製造工場において、使用した薬液の廃液の処理を誤り、塩化水素が発生して作業者が被災



【発生場所】

半導体素子製造工場でガリウム砒素ウエハーを製造しているクリーンルーム

【被災原因】

製造工程の膜付前洗浄作業では硫酸・過酸化水素・純水の混合液Mを、マーキング作業ではリン酸・塩酸の混合液Nを使用していた。M液とN液は別々に処理していたが、誤ってM液回収用のポリタンクにN液を投入にしたため、塩化水素ガスが発生した。

【被災状況】

ポリタンクから吹き出した白煙の塩化水素ガスがクリーンルーム内に広がり、室内にいた3名の作業者が目の痛みを訴え治療を受けた。

【対策】からの抜粋

[3] 廃液回収用ポリタンクは確実に蓋をし、又は適切な排気装置を設置するなどにより、ポリタンクから発生した化学物質の蒸気が作業室内に漏出しないようにすること



～理研計器からのご提案～

廃液回収容器のある室内など、化学物質の蒸気が漏出する可能性のある場所には、毒性ガスの漏洩を早期に検知し、警報を発する設備の設置をお勧めします。